



演題：私の金属・半導体表面のアノード酸化研究

講師：小野 幸子 先生

工学院大学 教授

日時：2015年10月23日（金）16:00~17:30

場所：北海道大学フロンティア応用科学研究棟

2階セミナー室

共催：北海道大学「物質科学フロンティアを開拓する Ambitious リーダー育成プログラム」

電気化学会・表面技術協会・腐食防食学会各北海道支部

小野幸子教授は、日本における金属・半導体のアノード酸化研究の第一人者で、アルミニウムを中心としたバルブ金属や化合物半導体表面にナノ構造制御した酸化皮膜を形成する研究を精力的に行っております。今回ご来学の機会に、これまでのアノード酸化研究についてご紹介いただけることになりました。電気化学分野で活躍されている女性研究者として、女性研究者・学生向けのお話も聞けるものと思います。皆様のご参加をお待ちしております。

連絡先：工学研究院物質化学部門 幅崎 浩樹（内線：6575）

文部科学省特別経費「分子構築イノベーション」